

01; 06.3; 07

© 1992

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ $GaInAsP/InP$
ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ С РАЗОГРЕТЫМИ
НОСИТЕЛЯМИ ЗАРЯДА

В.И. Т о л с т и х и н

Инжекционные лазеры (ИЛ) на основе твердых растворов $GaInAsP$ являются перспективными источниками излучения для волоконнооптических линий связи новых поколений [1]. Вместе с тем, они дают важный пример влияния разогрева носителей заряда в активной области (АО) лазерного диода на выходные характеристики излучателя [2]. Модель одномодового $GaInAsP$ ИЛ с разогретой электронно-дырочной плазмой (ЭПД) и его статические характеристики рассматривались ранее в работах [3, 4]. Цель настоящего сообщения состоит в анализе влияния разогревных эффектов на модуляционные свойства таких лазеров.

Будем исходить из теоретической модели [3, 4], представляющей ИЛ как неравновесную систему взаимодействующих между собой термализованных носителей заряда, LO -фононов и волноводных фотонов. В пространственно однородном приближении она описывается скоростными уравнениями:

$$\frac{dN_e}{dt} = \frac{J}{e \cdot d} - R_S - R_A - \gamma_\omega \cdot v_\omega \cdot N_\omega, \quad (1)$$

$$\frac{dE_e}{dt} = \frac{Q}{d} - W_{LO}\{f_{LO}\} - W_S + W_A + \gamma_\omega \cdot v_\omega \cdot N_\omega, \quad (2)$$

$$\frac{df_{LO}}{dt} = v_e \cdot (f_{LO,e} - f_{LO}) - v_d \cdot (f_{LO} - f_{LO,o}), \quad (3)$$

$$\frac{dN_\omega}{dt} = \beta_S R_S - (\alpha_\omega - \gamma_\omega) \cdot v_\omega \cdot N_\omega \quad (4)$$

для концентрации ЭДП N_e , плотности ее энергии E_e , функции распределения LO -фононов f_{LO} и эффективной плотности фотонов возбуждаемой моды (частоты ω) N_ω . Здесь d — толщина АО; J — плотность тока накачки; Q — плотность потока энергии; R_S , R_A и W_S , W_A — темпы спонтанной излучательной рекомбинации, оже-рекомбинации и темпы изменения плотности энергии ЭДП вследствие этих процессов; β_S — фактор спонтанной эмиссии возбуждаемой моды; γ_ω , α_ω и v_ω — ее коэффициенты усиления, затухания и групповая скорость, а γ_ω — коэффициент, определяющий вклад моды в изменение энергии ЭДП; W_{LO} — темп релаксации

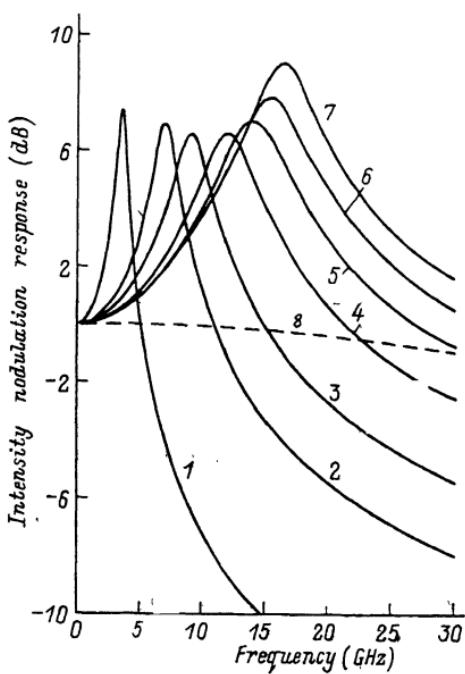


Рис. 1. Частотная зависимость малосигнального отклика интенсивности одномодового *GaInAsP* ИЛ ($\lambda = 1.55$ мкм; $J_{th} \approx 1.3$ кА/см 2 ; $T_0 = 300$ К). Цифрами отмечены кривые, соответствующие следующим значениям плотности инжекционного тока: 1 – $J = 1.40$ кА/см 2 ; 2 – $J = 2.86$ кА/см 2 ; 3 – $J = 4.30$ кА/см 2 ; 4 – $J = 7.11$ кА/см 2 ; 5 – $J = 9.78$ кА/см 2 ; 6 – $J = 12.30$ кА/см 2 ; 7 – $J = 14.65$ кА/см 2 ; 8 – $J = 34.20$ кА/см 2 .

энергии ЭДП на $L0$ -фононах. В уравнении (3) $f_{L0,e}$ и $f_{L0,o}$ – планковские функции распределения с температурой ЭДП T_e и температурой $L0$ -фононов (равновесных) T_o ; ν_e и ν_d – зависящие соответственно от параметров ЭДП и T_o частоты эмиссии и ангармонического распада $L0$ -фононов. Явный вид выражений для величин в правых частях скоростных уравнений (1)...(4), учитывающих процессы взаимодействия в электронно-фонон-фотонной системе АО, приведен в работах [3, 4]. Все они определяются в рамках четырехзонной модели Кейна с использованием обычной теории рассеяния квазичастич и являются функциями состояния ЭДП. Таким образом, развивающаяся модель ИЛ является самосогласованной. Этим она принципиально отличается от феноменологических моделей [5, 6], учитывающих разогрев носителей заряда лишь посредством эмпирически вводимой нелинейности коэффициента усиления и не рассматривающих динамику процесса.

Анализ разогревных эффектов проведем на примере прямой модуляции интенсивности типичного по своим параметрам (см. [4] и цитированную там литературу) *GaInAsP* ИЛ ($\lambda = 1.55$ мкм). Результаты численного расчета его нормированного малосигнального

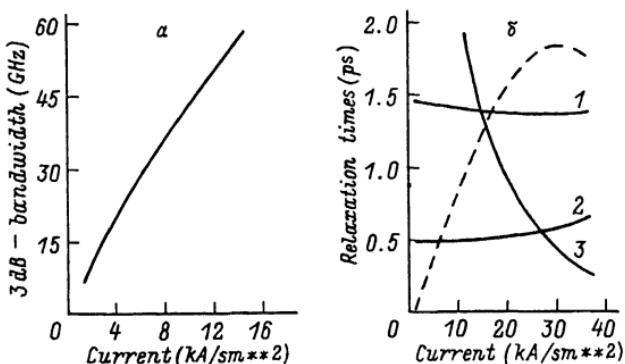


Рис. 2. Зависимость ширины полосы (по уровню 3 дБ) прямой модуляции интенсивности (а) и характерных времен релаксации (б) от плотности инжекционного тока. Цифрами на рис., б отмечены: 1 – τ_f ; 2 – $\tau_{\omega f}$; 3 – $\tau_{\omega N}$; штриховая кривая – эффективная плотность фотонов N_ω (в произвольных единицах).

отклика $\mu(f) = [\delta N_\omega(f)/\delta J(f)] / |\delta N_\omega(0)/\delta J(0)|$ на гармоническое (с частотой f) возмущение плотности инжекционного тока $\delta J(f) \cdot \exp(2\pi i f t)$ даны на рис. 1. Видно, что в широком интервале значений J частотная зависимость модуля этой величины $|\mu(f)|$ имеет характерный пик, отвечающий релаксационным колебаниям. Для сравнительно небольшого превышения порога генерации $J_{th} \approx 1.3$ кА/см² (кривые 1...3 на рис. 1) этот пик понижается и уширяется с ростом накачки, что соответствует результатам элементарной теории [7]. Однако при дальнейшем увеличении накачки величина резонансного пика вновь возрастает (кривые 4...6 на рис. 1) и в тем большей степени, чем сильнее межподзонное поглощение на дырках с переходом в спин-отщепленную подзону. Повторное снижение резонансного пика наступает уже для $J \gtrsim 15$ кА/см², а в области его существования ширина полосы прямой модуляции интенсивности (по уровню 3 дБ) практически линейно возрастает с увеличением плотности инжекционного тока (см. рис. 2, а). Для больших J зависимость $|\mu(f)|$ становится монотонной (штриховая кривая 8 на рис. 1), т. е. релаксационные колебания отсутствуют. Ширина полосы здесь меняется с уровнем накачки более медленно, насыщаясь на уровне $\sim 80 \dots 85$ ГГц.

Для физической интерпретации этих результатов рассмотрим временные характеристики релаксационных процессов в электрон-фонон-фотонной системе ИЛ. Наибольшим является рекомбинационное время жизни носителей заряда $\tau_N \sim (\partial(\rho_S + \rho_A) / \partial N_e)^{-1} \sim 1$ нс [8]. Наименьшим – время спонтанной эмиссии $L0$ -фона $\nu_e^{-1} \sim 0.1$ пс [8]. Так как оно значительно меньше времени ангармонического распада $L0$ -фона $\nu_d^{-1} \sim 3 \dots 7$ пс [9], то процесс остывания плотной ЭДП происходит в условиях фононного узкого горла [10]. Сначала, практически без изменения T_e , эмиссия $L0$ -фонов приводит к установлению их квазистационарного распределения вида

$f_{LO,s} = (\nu_e \cdot f_{LO,e} + \nu_d \cdot f_{LO,o}) / (\nu_e + \nu_d)$, а уже затем T_e и $f_{LO,s}$ релаксируют к равновесному состоянию с характерным временем $\tau_{T^*} \cdot \zeta \cdot N \cdot (\partial W_{LO} / \partial T_e)^{-1}$, где ζ – параметр, зависящий от нормированных химических потенциалов с- и σ -зон $\xi_{c,\sigma}$ [3, 4]:

$$\zeta = 1.5 \cdot \sum_{j=c,\sigma} \left(2.5 \cdot F_{3/2}(\xi_j) / F_{1/2}(\xi_j) - 1.5 \cdot F_{1/2}(\xi_j) / F_{-1/2}(\xi_j) \right).$$

В актуальных условиях оно составляет $\sim 1 \dots 2$ пс. (см. рис. 2, б) и оказывается заметно большим, чем можно было бы ожидать без учета неравновесности LO-фононов, но близким к экспериментальному [11]. Время релаксации фотонов определяется (в меру малости фактора спонтанной эмиссии $\beta_s \ll 1$) чувствительностью разницы $(\alpha_\omega - \gamma_\omega)$ к динамическим изменениям состояния ЭДП. В изотермической плазме $T_e \approx const$ усиление и поглощение зависят лишь от ее концентрации N_e и это время $\tau_{\omega T}$ оценивается, как $\tau_{\omega T}^{-1} \sim \omega \cdot |\partial(\alpha_\omega - \gamma_\omega) / \partial \ln N_e|$. Разогрев ЭДП приводит к падению межзонного усиления и росту внутризонного поглощения, возникающим, соответственно, из-за подавления инверсности заселенностей и активации излучательных переходов дырок в спин-отщепленную подзону [3, 4]. Влияние этих процессов можно описать параметром $\tau_{\omega N}$, где $\tau_{\omega N}^{-1} \equiv \omega \cdot |\partial(\alpha_\omega - \gamma_\omega) / \partial \ln T_e|$, имеющим смысл времени релаксации при $N_e \approx const$. Если $\varepsilon_T, \tau_{\omega T} \ll \tau_{\omega N}$, то релаксация фотонов определяется концентрационной зависимостью γ_ω и α_ω , так, что на временном масштабе, большем ε_T , ситуация не отличается от изотермической. При этом на быстрое изменение J ИЛ отвечает релаксационными колебаниями N_e и N_ω [7] с частотой f_{RT} и постоянной затухания τ_{RT} вида:

$$f_{RN} \sim \frac{\omega}{2\pi} \cdot \left(|\gamma_\omega \cdot \frac{\partial}{\partial N_e} (\alpha_\omega - \gamma_\omega)| \cdot N_\omega \right)^{1/2}; \quad \tau_{RT}^{-1} \sim \tau_N^{-1} + \omega \cdot \frac{\partial \gamma_\omega}{\partial N_e} \cdot N_\omega.$$

Критерий их существования $2\pi f_{RN} \tau_{RT} \gg 1$ заведомо выполняется для некоторого интервала плотностей тока в силу неравенства $2\pi f_{RT} \tau_N \gg 1$. Так как $\partial \gamma_\omega / \partial N_e > 0$, то добротность колебаний монотонно падает с ростом J . Если $\tau_{\omega N} \ll \tau_{\omega T}, \varepsilon_T$, то релаксация фотонов определяется температурной зависимостью γ_ω и α_ω . При этом в условиях интенсивного межподзонного поглощения на дырках могут возникать релаксационные колебания T_e и N_ω с частотой f_{RN} и постоянной затухания τ_{RN} вида:

$$f_{RN} \sim \frac{\omega}{2\pi} \cdot \left(|\gamma_\omega \cdot \frac{\partial}{\partial T_e} (\alpha_\omega - \gamma_\omega)| \cdot (N_\omega / 5N_e) \right)^{1/2}; \quad \tau_{RN}^{-1} \sim \tau_T^{-1} - \omega \cdot \frac{\partial \gamma_\omega}{\partial T_e} \cdot (N_\omega / 5N_e).$$

В силу неравенств $2\pi f_{RN} \tau_T \ll 1$ и $\partial \gamma_\omega / \partial T_e \sim [(\hbar\omega - \Delta_S)/T_e]^2 \alpha_{SW} > 0$, где Δ_S – энергия спинового расщепления в валентной зоне, α_{SW} –

коэффициент межподзонного поглощения на дырках, критерий их существования $2\pi f_{RT} \tau_{RT} \gtrsim 1$ выполняется лишь для $\tau_{RN} \cdot \nu_{\omega} (\partial \eta_{\omega} / \partial T_e) \times (N_{\omega} / \zeta N_e) \sim 1$, при том что добротность колебаний немонотонно зависит от J . Если это условие не выполнено, то релаксационный процесс имеет апериодический характер с постоянной затухания $\sim \tau_{RN}$.

На рис. 2, б даны результаты численного расчета характерных времен релаксации τ_T , $\tau_{\omega T}$ и $\tau_{\omega N}$. Видно, что в широком диапазоне изменения J время остыния ЭДП τ_T и время изотермической релаксации фотонов $\tau_{\omega T}$ слабо зависят от накачки, оставаясь в пределах соответственно $\sim 1.5 \dots 1.4$ пс и $\sim 0.5 \dots 0.6$ пс. Что же касается времени $\tau_{\omega N}$, то оно меняется по порядку величины – от ~ 10 пс для $J \approx J_{th}$ до ~ 0.2 пс для $J \approx 30J_{th}$, причем такая резкая зависимость $\tau_{\omega N}(J)$ обусловлена экспоненциальнym нарастанием межподзонного поглощения на дырках при их разогреве [3]. Лишь для области $J \leq 10$ кА/см² ситуация близка к первому из описанных предельных случаев, когда обратная связь в электрон–фотонной системе является чисто концентрационной и высокочастотный отклик ИЛ (кривые 1 ... 3 на рис. 1) аналогичен изотермическому. С ростом J существенными становятся неизотермичность ЭДП и температурная обратная связь в электрон–фотонной системе. В результате усиливается вклад релаксационных колебаний T_e и N_e , соответствующих второму из описанных предельных случаев, и величина резонансного пика на амплитудно–частотной характеристике сначала возрастает (кривые 4 ... 6 на рис. 1), а затем падает по мере увеличения плотности тока, что и наблюдается в некоторых экспериментах [12]. Для достаточно больших J , релаксационный процесс становится апериодическим, а его скорость определяется временем остыния ЭДП (штриховая кривая на рис. 1), мало меняющимся в разумном интервале значений плотностей тока (см. кривую 1 на рис. 2, б). Таким образом, разогрев ЭДП приводит к усложнению спектра релаксационных колебаний и уширению полосы прямой модуляции.

В заключение автор благодарит С.А. Егорова за стимулирующие дискуссии и полезное обсуждение результатов работы.

Список литературы.

- [1] Косин Т.Л., Кондрат У. // J. Lightwave Techn. 1990. V. LT-8. N 3. P. 274–293.
- [2] Wada O., Yamakoshi S., Sakurata. // Appl. Phys. Lett. 1982. V. 41. N 10. P. 981–983.
- [3] Пишалко В.Д., Толстыхин В.И. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 3. С. 462–471.
- [4] Толстыхин В.И. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. В. 14. С. 1–6.

- [5] G o m a t a m B.N., D e F o n z o A.P. // J. Appl. Phys. 1988. V. 64. N 3. P. 1555-1557.
- [6] G o m a t a m B.N., D e F o n z o A.P. // IEEE. J. Quant. Electron. 1990. V.QE-26. N 10. P. 1689-1704
- [7] Полупроводниковые инжекционные лазеры. Динамика, модуляция, спектры. п/р. У. Тсанга. М.: Радио и связь. 1990. 320 с.
- [8] D u t t a N., W i l s o n R., W i l t D. e. a. // ATT Techn. J. 1985. V. 64. N 8. P. 1857-1884.
- [9] P o t z W., K o c e v a r P. // Phys. Rev. 1983. V. B28. N 12. P. 7040-7047.
- [10] Кумеков С.Е., Переиль В.И. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. В. 1. С. 346-356.
- [11] K e s l e r M.P., I p p r e n E.P. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51. N 22. P. 1765-1767.
- [12] T u c k e r R.S., K a m i n o v L.P. // J. Light-wave Techn. 1984. V. LT-2. N 4. P. 385-393.

Поступило в Редакцию
14 сентября 1992 г.